

○ 毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令 新旧対照条文  
 ○ 毒物及び劇物指定令 (昭和四十年政令第二号) (抄)

(傍線の部分は改正部分)

改正後	改正前
<p>(毒物)</p> <p>第一条 毒物及び劇物取締法 (以下「法」という。) 別表第一第二十八号の規定に基づき、次に掲げる物を毒物に指定する。</p> <p>一 一七の二 (略)</p> <p>十八 (略)</p> <p>イ (略)</p> <p>ロ 硫黄、カドミウム及びセレンから成る焼結した物質並びにこれを含む製剤</p> <p>ハ・ニ (略)</p> <p>十九 一三十一 (略)</p> <p>(劇物)</p> <p>第二条 法別表第二第九十四号の規定に基づき、次に掲げる物を劇物に指定する。ただし、毒物であるものを除く。</p> <p>一 一四の三 (略)</p>	<p>(毒物)</p> <p>第一条 毒物及び劇物取締法 (以下「法」という。) 別表第一第二十八号の規定に基づき、次に掲げる物を毒物に指定する。</p> <p>一 一七の二 (略)</p> <p>十八 セレン化合物及びこれを含む製剤。ただし、次に掲げるものを除く。</p> <p>イ 亜セレン酸ナトリウム <math>\text{O} \cdot \text{O} \cdot \text{O} \cdot \text{O} \cdot \text{O} \cdot \text{O}</math> 一%以下を含む製剤 (新設)</p> <p>ロ ゲルマニウム、セレン及び砒素から成るガラス状態の物質並びにこれを含む製剤</p> <p>ハ (略)</p> <p>十九 一三十一 (略)</p> <p>(劇物)</p> <p>第二条 法別表第二第九十四号の規定に基づき、次に掲げる物を劇物に指定する。ただし、毒物であるものを除く。</p> <p>一 一四の二 (略)</p> <p>四の三 二アミノエタノール及びこれを含む製剤。ただし、二</p>

四の四 N—(ニ—アミノエチル) —ニ—アミノエタノール及びこれを含有する製剤。ただし、N—(ニ—アミノエチル) —ニ—アミノエタノール—〇%以下を含有するものを除く。

四の五〜四の七 (略)

五〜十三の三 (略)

十三の四 ニ—エチル—三・七—ジメチル—六—〔四—(トリフルオロメトキシ) フエノキシ〕—四—キノリル—メチル—カルボナート及びこれを含有する製剤

十三の五 (略)

十四〜二十一 (略)

二十二 カドミウム化合物。ただし、硫黄、カドミウム及びセレンから成る焼結した物質を除く。

—アミノエタノール二〇%以下を含有するものを除く。

(新設)

四の四 L—ニ—アミノ—四—〔(ヒドロキシ) (メチル) ホスフィンイル〕ブチリル—L—アラニル—L—アラニン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、L—ニ—アミノ—四—〔(ヒドロキシ) (メチル) ホスフィンイル〕ブチリル—L—アラニル—L—アラニンとして一九%以下を含有するものを除く。

四の五・四の六 (略)

五〜十三の二 (略)

十三の三 O—エチル—S・S—ジプロピル—ホスホロジチオアート (別名エトプロホス) 五%以下を含有する製剤。ただし、O—エチル—S・S—ジプロピル—ホスホロジチオアート三%以下を含有する徐放性製剤を除く。

(新設)

十三の四 ニ—エチルチオメチルフエニル—N—メチルカルバメート (別名エチオフェンカルブ) 及びこれを含有する製剤。ただし、ニ—エチルチオメチルフエニル—N—メチルカルバメート二%以下を含有するものを除く。

十四〜二十一 (略)

二十二 カドミウム化合物

二十二の二〜三十一 (略)

三十一の二 シアナミド及びこれを含有する製剤。ただし、シアナミド一〇%以下を含有するものを除く。

三十一の三 (略)

三十二 有機シアン化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1)〜(3) (略)

(4) 四・四―アゾビス(四―シアノ吉草酸)及びこれを含有する製剤

(5) (31) (略)

(32) (E)―〔(四RS)―四―(ニ―クロロフェニル)―一・三―ジチオラン―ニ―イリデン〕―(一H―イミダゾール―一―イル

―)アセトニトリル及びこれを含有する製剤

(33) (91) (略)

二十二の二〜三十の六 (略)

三十一 酸化水銀五%以下を含有する製剤 (新設)

三十一の二 四―ジアリルアミノ―三・五―ジメチルフェニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤

三十二 有機シアン化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1)〜(2) (略)

(3) アセトニトリル四〇%以下を含有する製剤 (新設)

(4) 五―アミノ―一―(二・六―ジクロロ―四―トリフルオロメチルフェニル)―四―エチルスルフィニル―一H―ピラゾール―三―カルボニトリル(別名エチプロール)及びこれを含有する製剤

(5) (29) (略)

(30) 一―(三―クロロ―四・五・六・七―テトラヒドロピラゾロ―一・五―a)ピリジン―ニ―イル)―五―「メチル(プロプ―ニ―イン―一―イル)アミノ」―一H―ピラゾール―四―カルボニトリル(別名ピラクロニル)及びこれを含有する製剤

(新設)

(31) 二―(四―クロロフェニル)―二―(一H―一・二・四―トリ

2

三十三〽百九 (略)

- (94) | (176) | (略)
- (93) | (E) | 「(四R) | 四 | (二・四 | ジクロロフェニル) | 三 | ジチオラン | 二 | イリデン」 | (H | イミダゾール | イル) | アセトニトリル及びこれを含有する製剤
- (92) | 一 | (二・六 | ジクロロ |  $\alpha$ ・ $\alpha$  | トリフルオロ | p | リル) | 四 | (ジフルオロメチルチオ) | 五 | 「(二 | ピリジ | メチル) | アミノ」 | ピラゾール | 三 | カルボニトリル (別名ピリ | ロール) | 二・五%以下を含有する製剤

2

三十三〽百九 (略)

- (91) | (172) | (略)
- (90) | ジシアンジアミド及びこれを含有する製剤
- (新設) | (89) | (32) | (88) | (略)
- 三・四 | ジクロロ | シアノ | 二 | チアゾール | 五 | カ | ルボキサニリド (別名イソチアニル) 及びこれを含有する製剤
- (新設) | アゾール | イルメチル) | ヘキサニトリル (別名ミクロブタ | ニル) 及びこれを含有する製剤